ORGANIC EL ELEMENT AND MANUFACTURE THEREOF

Publication number: JP7169569 (A)

Publication date: 1995-07-04

Inventor(s): KAWAMURA HISAYUKI; HIRONAKA YOSHIO

Applicant(s): IDEMITSU KOSAN CO
Classification:

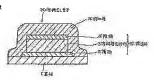
- international: H05B33/04; H01L51/50; H05B33/10; H05B33/04; H01L51/50; H05B33/10; (IPC1-

7): H05B33/04; H05B33/10 - European:

Application number: JP19930343925 19931217
Priority number(s): JP19930343925 19931217

Abstract of JP 7169569 (A)

PURPOSE:To prevent the degradation caused by heat at sealing layer forming time, and maintain a stable light emitting characteristic over a long period of time by lavering a sealing laver forming monomer outside of a structure body by evaporationpolymerization, and forming a sealing layer. CONSTITUTION:A structure body 10 constituted by sandwiching an organic light emitting material between a pair of mutually opposing electrodes 2 and 4 whose at least one is transparent or semitransparent, is arranged on a substrate 1. A sealing layer 5 by layering and forming a sealing layer forming monomer by evaporationpolymerization, is arranged outside of the substrate 1 and the structure body 10. A polymerization temperature in this evaporation-polymerization is preferable to be not more than 300 deg.C. The sealing layer forming monomer is preferable to be a monomer selected from a group composed of an epoxy monomer, a cinnamic acid ester monomer and a carbene monomer.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Fan	

1 application(s) for: JP7169569

	AND MANUFACTURE THEREOF

Inventor: KAWAMURA HISAYUKI ; HIRONAKA Applicant: IDEMITSU KOSAN CO

YOSHIO EC: IPC: H05B33/04; H01L51/50; H05B33/10; (+5)

Publication info: JP7169569 (A) — 1995-07-04

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本國特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A) (11)特許出願公開番号

特開平7-169569

(43)公開日 平成7年(1995)7月4日

(51) Int.CL⁶

識別配号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H 0 5 B 33/04 33/10

審査請求 未請求 請求項の数8 FD (全 8 頁)

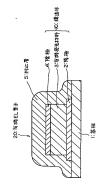
(21)出願番号	特顯平5-343925	(71)出顧人 000183646 出光興産株式会社
(22) 出願日	平成5年(1993)12月17日	東京都千代田区丸の内3丁目1番1号 (72)発明者 川村 久幸
		千葉県袖ケ浦市上泉1280番地 出光興産株 式会社内
		(72)発明者 弘中 義雄 千葉県袖ケ浦市上泉1280番地 出光興産株 式会社内
		(74)代理人 弁理士 渡辺 喜平 (外1名)

(54) 【発明の名称】 有機EL素子およびその製造方法

(57) 【要約】

【目的】 封止層形成時の熱による劣化を防止し、長期 に亘って安定な発光特性が維持されるとともに、長寿命 の有機EL素子を提供する。

【構成】 一対の電極間2,4に有機発光材料3を挟持 してなる構造体10を基板1上に配設し、その構造体1 0の外側に、封止層形成モノマーを蒸着重合によって積 層し、封止層5を形成する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 その少なくとも一方が透明または半透明 の互いに対向する一対の電極間と有機発光材料を挟持し てなる構造体、およびその構造体の外側に形成された封 止層を有する有機EL業子において、

前記封止層が、封止層形成モノマーを蒸着重合によって 前記構造体の外側に積層、形成してなるものであること を特徴とする有機EL素子。

【請求項2】 前記蒸着重合における重合温度が、300℃以下であることを特徴とする請求項1記載の有機ET ※子

【請求項3】 前記封止屬形成モノマーが、エポシキ系 モノマー、ケイ皮酸エステル類モノマーおよびカルベン 類モノマーからなる群から選ばれる一以上のモノマーか らなるものであることを特徴とする請求項1又は2配載 の有機EL素子.

【請求項4】 前記封止層の厚さが、 $1 \mu m \sim 1 mm$ で あることを特徴とする請求項 $1 \sim 3 のいずれか1$ 項記載 の有機EL素子。

【請求項5】 その少なくとも一方が透明または半透明 の互いに対向する一対の電極間に有機発光材料を挟持し てなる構造体の外側に、封止層を形成する有機EL素子 の製造方法において、

前記構造体の外側に封止層を形成する工程が、封止層形 成モノマーを蒸着重合によって前記構造体の外側に積層 する工程を含むものであることを特徴とする有機EL素 子の製造方法。

【請求項6】 前記蒸着重合における重合温度が、300℃以下であることを特徴とする請求項5記載の有機E L.妻子の製造方法。

【請求項7】 前記針止層形成モノマーが、エポキシ系 モノマー、ケイ皮酸エステル類モノマーおよびカルベン 類モノマーからなる群から選ばれる一以上のモノマーか らなるものであることを特徴とする請求項5または6記 歳の有機FL素子の製造方法。

【請求項8】 前記封止層の厚さが1μm~1mmであることを特徴とする請求項5~7のいずれか1項記載の 有機EL素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、有機EL (電界発光) 素子に関する。さらに詳しくは、主に、情報産業機器用 の各種ディスプレーや発光素子に好適に用いられる、長 期に亘って安定な発光特性が維持され、長寿命の有機E L妻子に関する。

[0002]

【従来の技術】 E L 素子には無機 E L 素子 と 育機 E L 素 子 と があり、いずれの E L 薬子も 自己 発光性 であるため に視認性が高く、また完全 固体素子であるために耐衝撃 性に優れるとともに取扱いが容易である。このため、グ ラフィックディスプレイの画素やテレビ画像表示装置の 画素、または面光源等としての研究開発および実用化が 進められている。

[0003] 有機已上業子は、互いに対向する2つの電極の間に有機物を扶持する精造体であり、有機物はさらに発光期、正孔柱入屋/発光期の電子性入層、発光層/電子柱入層、元孔柱入屋/発光度/電子柱入層のような積層体か、または、正孔注入材料と電子柱入材料のうち少なくとも一と発が材料と電景をは、正孔注入材料と電子は入材料の方のかなくとが表現には当り、Mg、Al, Inなどの仕事関数の小さな物質が用いられ、陽極にはAu, Ni, ITのなどの仕事関数が大きな物質が用いられる。また発光節則の電極は発光した光を通すように透明または半透明であ

【0004】にのような有機足上素子は、発光材料に注入された電子と正孔とが再結合するときに生じる発光を利用するものである。このため有機及L素子は、発光層の厚さを薄くすることにより例えば4.5℃という低値圧での駆動が可能で応答も遠いといった利点や細度が注入電池に使けるために高速度のEL素子を得ることができるといった利点を有している。また、発光材料の蛍光性の有機固体の循環を変えることにより、青、緑、赤の可観速すべての色で発光を得ることができる。有機EL素子は、このような利点、特に低電圧での駆動が可能であるという利点を有していることから、現在、実用化のために研究が続けられている。現在、実用化のために研究が続けられている。

【0005】ところで、有機DL素子の発光材料や正孔 注入材料、電子往入材料である有機固体は水分、酸素等 に侵され場か、また、有機関係上に設けられる電框(対 向電極)は、酸化により特性が劣化する。このため、従 来の有機DL素子を大気中で駆動させると発光特性が急 数に劣化する。したかって、実用的な有機DL素子を得 るためには有機固体に水分や酸素が侵入しないように、 また、対向電極が酸化されないように、素子を封止して 長寿命化を図る必要がある。

【0006】このような有機EL素子の封止法として は、気相重合法でパラキシレンの薄膜を順厚0.1~2 0 μ mで有機EL素子の上に設ける方法(特開平4-13748、3号公報、および同5-101886号公報) が開示されている。

[0007]

【発明が解決しようとする悪個 しかし、この方法はオ レフィンを重合させるために高熱 (700℃以上)によ って反応させる必要があった。有機 E L 素子は熱に弱い ので、気相中で反応させるとはいえ、放射熱による素子 の劣化が問題となっていた。本発明は上述の問題に認み なされたものであり、対止解析の時か熱による分化を妨 止し、長期に亘って安定な発光特性が維持されるととも に、長寿命の有機 E L 素子を提供することを目的とす。

[0008]

【課題を解決するための手段】その少なくとも一方が透明または半透明の互いに対向する一対の電極関に有機及 財表には半透明の互いに対向する一対の電極関に有機及 大松料を技練してなる構造体、おしてその構造体の外側 に形成された封止層を有する有機 DL 茶子において、前 記封上層形成・対止層形成ナノマーを募奪重合によって前 記得造体の外側に視順、形成してなるものであることを 特徴とする有機 DL 茶子が提供される。

【0009】また、前記蒸着重合における重合温度が、 300℃以下であることを特徴とする有機EL素子が提 供される。

【0010】また、前記封止層形成モノマーが、エポシキ系モノマー、ケイ皮酸エステル類モノマーおよびカルベン類モノマーからなる群から選ばれる一以上のモノマーからなるものであることを特徴とする有機EL素子が提供される。

【0011】また、前記封止層の厚さが、1μm~1m mであることを構修とする情報EL票子が提供される。 [0012] また、その少なくとも一方が透明または半 透明の互いに対向する一対の電極間に有機発光材料を挟 持してなる構造体の外側に、封止層を形成する有線EL 素子の製造方法において、前記構造体の外側に対止層を 形成する工程が、封止層形表とすべーを蒸着重合によっ て前記報途体の外側に規関する工程を含むものであるこ とを特徴とする情報と非不の製造力法が提供される。 [0013]また、前記素者会における監合地度がある。 [0013]また、前記素者会における監合地度がある。

【0013】また、前記蒸着重合における重合温度が3 00℃以下であることを特徴とする有機EL素子の製造 方法が提供される。

【0014】また、前記針止層形成モノマーがエポキシ系モノマー、ケイ皮酸エステル類モノマーおよびカルベン類モノマーからなる群から選ばれる一以上のモノマーからなるものであることを特徴とする有機EL来子の製造方法が提供される。

【0015】さらに、前記封止層の厚さが1μm~1m mであることを特徴とする有機EL素子の製造方法が提供される。

【0016】以下、本発明の有機EL集子およびその製造方法を具体的に説明する。本発明の有機EL集子は、その具体例を図1に示すように、その少なくとも一方が透明または半透明の互いに対向する一対の電極2.4間に有機発光材料3を挟持してなる構造体10を基を11、正配設し、その基板1およびその構造体10の外側に封止層形成セノマーを蒸着重合によって機層、形成した封止層を含せている。以下、各構成要素について順次説明する。

【0017】1. 構造体

本発明に用いられる素子の構造体の構成は、特に限定さ れるものではなく任意の構成を振ることができる。たと えば、陽極/発光層/陰極、陽極/正孔往入層/発光層 /陰極、陽極/発光層/電子注入層/陰極、又は陽極/ 正孔注入層/発売層/電子在入層/陰極を挙げることが できる。また各層が複数の脚の積層体でもよい、これらの有機物各層はたとえ ば物膜平ちーの28659号に提案された有機物を入り た容器を電子機能にり加熱して、企の模様物を全かの結 た容器を電子機能にり加熱して、企の模様物を一方の電 様上に堆積させて有機物を一方の電 様上に堆積させて有機物層を形成する方法を用いて形成 することができる。各層の厚さは特に限定されるもので はない、路陽の電機を除いた各層機の上ま子に使加まる ち」加である。まだ材料は端唇を上ま子に使加 ものなら時に限定されない、以下、具体的に、陽極/正 孔注人権法層/発光層/電子往入他法層/隆極からなる 有機 E 1素子の様とのそのないで説明する。

【0018】①基板 本発明に用いられる有機EL素子の構造体は、基板上に

て形成することが好ましい。本発明に用いられる基板 は、透明性を有するものが好ましく、具体的にはガラ 、透明プラスチック, 石英などを挙げることができ る。

【0019】②電極

本発明に用いられる電極は、その少なくとも一方が適明 または半適明の互いに対向する一対の電極(陽極及び陰 極)からなる。適明または半透明とするのは透光性を得 るためである。

②-1 陽極

本発明上用いられる有機日上票子における結極として、 仕事関数の大きい (4 e V以上) 全島、合金、電気 伝導性化合物及でよれらの混合物を電磁物質とするもの を好適に用いることができる。このような電極物質の具体例としてはんなどの金属、Cul, ITO、Cul, ITO、Gを装着マイパッタ・リングなどの方法により、海峡を登りることができる。 該結権は、これらの植物質が おりがませることにより作成することができる。この電極より 発光を取り出す場合には、透過率を10%よりたまぐす 哲 G / Clu 以下とすることがなました。また、電板上 してのシート 社内 野 近 で J に 野 で J に 野 で J に 野 で J に 野 で J に 野 で J に 野 で J に 野 で J い で J に 野 で J い で J

【0020】②-2陰極

一方、陰極としては、仕事関数の小さい(4 e V以下) 金属、合金、電気伝導性化合物及びこれらの混合物を電 植物質とするむのを用いることができる。このような電 植物質の具体側としては、ナトリウム、ナトリウムーカ リウム合金、マグネシウム、リチウム、マグネシウム/ 刺混合物、AJ (Al, O,)、インジウム、希士撰 金属などを挙げることができる。該陰極は、これらの電 極物質を蒸着やスペッタリングなどの力勢により、薄膜 を形成させることにより、作成することができる。ま 電化してのシート抵抗は数百0/口以下とするこ とが好ましく、機厚は通常 1 0 n m ~ 1 μ m, 好ましく は50~200 n mの範囲で選ぶことができる。なお、 ○のE L 第千においては、接触極又は陰極のいずれかー 方を通明又は半透明とすることが、電極自体が発光を通 過して、発光の限り出し効率を向上させるため好まし

【0021】③発光層

発光層の材料として使用可能な有機化合物としては、特 に限定はないが、ベンゾチアゾール系、ベンゾイミダゾ ール系、ベンゾオキサゾール系等の蛍光増白剤、金属キ レート化オキシノイド化合物、スチリルベンゼン系化合 物等を挙げることができる。

【0022】具体的に化合物名を示せば、例えば、特開 昭59-194393号公報に開示されているものを挙 げることができる。その代表例としては、2,5-ビス (5. 7-ジーt-ペンチルー2-ベンゾオキサゾリ ル) -1, 3, 4-チアジアゾール、4, 4' ービス (5、7-t-ペンチル-2-ベンゾオキサゾリル)ス チルベン、4, 4' ーピス [5, 7ージー (2ーメチル -2-ブチル)-2-ベンゾオキサゾリル]スチルベ ン、2、5-ビス (5、7-ジ-t-ペンチル-2-ベ ンゾオキサゾリル) チオフェン、2、5-ビス「5-チオフェン、2,5-ビス[5,7-ジー(2-メチル -2-ブチル) -2-ベンゾオキサゾリル] -3, 4ジ オフェニルチオフェン、2,5-ビス(5-メチル-2 ーベンゾオキサゾリル)チオフェン、4、4'ービス (2-ベンゾオキサゾリル) ビフェニル、5-メチルー 2-「2-「4-(5-メチル-2-ベンゾオキサゾリ ル) フェニル] ビニル] ベンゾオキサゾール、2-[2 - (4-クロロフェニル) ビニル] ナフト「1、2d] オキサゾール等のベンゾオキサゾール系、2-2' - (p-フェニレンジビニレン) -ビスベンゾチアゾー ル等のベンゾチアゾール系、2-「2-「4-(2-ベ ンゾイミダゾリル) フェニル] ビニル] ベンゾイミダゾ ール、2-「2-(4-カルボキシフェニル) ピニル] ベンゾイミダゾール等のベンゾイミダゾール系等の蛍光 増白剤を挙げることができる。さらに、他の有用な化合 物は、ケミストリー・オブ・シンセティック・ダイズ1 971.628~637百お上び640百に列挙されて いる。

【0023】前配キレート化オキシノイド化合物としては、例えば特開昭63-295695号公報に開示されているものを用いることができる。その代表例としては、トリス(8ーキノリノール)アルミニウム、ビス(8ーキノリノール)平がネシウム、ビス(ベング[f] -8ーキノリノール)亜鉛、ビス(2ーメチルー8ーキノリノール)インジウム、トリス(5ーメチルー8ーキノリノール)アルミニウム、キュインチント、8ーキノリノール

リチウム、トリス(5 - クロロー 8 - キノリノール)ガル リウム、ドス(5 - クロロー 8 - キノリノール)カルシ ウム、ポリ 圧鉛 (II) - ピス(8 - ヒドロキシー 5 -キノリノニル)メタン〕等の8 - ヒドロキシキノリン系 金属機体やジリチウムエピントリジオン等を挙げること ができる。

【0024】また、前股ステリルベンゼン系化合物としては、例えば欧州特許第0379881号明語率や欧州特許第0373582号明語書に開示されているものを用いることができる。その代表例としては、1、4-ビス(2-メチルスチリル)ベンゼン、1、4-ビス(4-メチルスチリル)ベンゼン、2-メチルスチリル、ベンゼン、1、4-ビス(3-エチルスチリル)ベンゼン、1、4-ビス(2-メチルスチリル)ベンゼン、1、4-ビス(2-メチルスチリル)ベンゼン、1、4-ビス(2-メチルスチリル)モンギン、1、4-ビス(3-エチルスチリル)モンギンド、1、4-ビス(3-エチルスチリル)モンギンギン等を挙げることができる。

ることができる。
「0025」また、特開平2-252793号公報に開示されているジスチリルビラジン誘導体も発光層の材料として用いることができる。その代表例としては、2,5ービス(4-エチルスチリル)ビラジン、2,5ービス (4-エナルンチリル)ビラジン、2,5ービス (4-エトルンチリル)ビラジン、2,5ービス (4-エトルンチリル)ビラジン、2,5ービス (4ービフェニル)ビニル】ビラジンをを挙げることができる。その他のものとして、例えば欧州特許第0387715号明練事に開示されているポリフェニル系 化合物も発光層の材料として用いることもできる。「0026】またに、計法、企業地自納。金属エレー

ト化オキシノイド化合物、およびスチリルベンゼン系化 合物等以外に、例えば12-フタロペリノン (J. Appl. Phys., 第27巻, L713 (1988年)), 1, 4 ージフェニルー1, 3ープタジエン、1, 1, 4, 4-テトラフェニルー1, 3ブタジエン(以上Appl. Phys. Lett., 第56巻, L799 (1990年))、ナフタル イミド誘導体 (特開平2-305886号公報). ペリ レン誘導体(特開平2-189890号公報)、オキサ ジアゾール誘導体 (特開平2-216791号公報 ま たは第38回応用物理学関係連合議演会で浜田らによっ て開示されたオキサジアゾール誘導体)、アルダジン誘 遊体(特開平2-220393号公報)、ピラジリン誘 導体(特別平2-220394号公報)、シクロペンタ ジエン誘導体(特開平2-289675号公報)、ピロ ロピロール誘導体(特開平2-296891号公報)、 スチリルアミン誘導体 (Appl. Phys. Lett., 第56巻, L799 (1990年))、クマリン系化合物(特開平 2-191694号公報)、国際公開公報WO90/1 3 1 4 8 PAppl. Phys. Lett., vol 58, 18, P1982 (1991)

に記載されているような高分子化合物等も、発光層の材料として用いることができる。

【0027】本処甲では、特に発光層の材料として、芳 審族ジメチリディ系化合物(成州幹計第038876 8号明維帯や特別平3-231970号公報に開示のも の)を用いることが好ましい。具体例としては、1,4 インエニレンジメチリディン、4,4-フェニレンジメ チリディン、2,5-キンレンジメチリディン、2,6 ナフテレンジメチリディン、1,4-ビフェニレンジ メチリディン、1,4-p-アレフェニレンジメチリディン、3,10 イン、9,10-アントラセンジイルジルメチリディ バース・2、4,4'ービス(2,2-ジラニ ニルビニル)ビフェニル等、およびそれらの誘導体を挙 げることができる。

【0028】このようにして形成される発光機の厚さにいては特に限定性なく、状況に応じて適宜選択することができるが、通常5nm-5μmの範囲が好ましい。 有機BL崇干における発光層は、電界印加時に、陽極または正孔北上周から正孔をとルイることができる人機能、 独入された電荷 (電子と正孔)を電界の力で移動きる場合を提供し、これを発光につなげる発光機能等を有している。 なお、正孔の住入されやすさと電子の注入されやすさとの側には違いがあった場かない。また、正孔と電子の影動度で表される輸送機能に大小があってもよいが、少なくともどちらか一方を移動させることが好ましい。

必要に応じて設けられる正孔注入層の材料としては、従来より光伝導材材の正孔走入材料として復用されている のや有機日、選手の正孔注入層に使用されている公如 のものの中から伝意のものを選択して用いることができ る。正在注入層の材料は、正孔の注入、電子の摩壁性の いづれかを有するものであり、有機物あるいは無機物の どちでもよい。

【0030】 具体例としては、例えばトリアゾール情報 作 (米国特幹3,112,197号明緒審等無限)、大 キサシアゾール情導体(米国特幹3,189,447号 明細審等無限)、イミグゾール情導体(米公昭37-1 6096号公積等参照)、ボリアリールアルカン込酵体 (米国特許3,615,402号明維春、阿第3,82 0,989号明維年、阿第3,542,544号明 8、参公昭45-555号公線、同51-10983号 公線、特開昭51-93224号公線、同55-108 667号公県、同56-4148号公線、同55-108 667号公県、同55-1569号線、同55-108 667号公県、同55-1569号線、同56-36656号公県等季照)、ビラゾリン誘導体およびビ ラブロン誘導体、米国特等第3,180,729号明維、 下面等4、天18,746号刺離、特階655-8 8064号公報、同55-88065号公報、同49-105537号公報。同55-51086号公報。同5 6-80051号公報、同56-88141号公報、同 57-45545号公報。同54-112637号公 報、同55-74546号公報等参照)、フェニレンジ アミン誘導体 (米国特許第3, 615, 404号明細 書、特公昭51-10105号公報、同46-3712 号公報、同47-25336号公報、特開昭54-53 435号公報、同54-110536号公報、同54-119925号公報等参照)、アリールアミン誘導体 (米国特許第3, 567, 450号明細書、同第3, 1 80,703号明細書、同第3,240,597号明細 書、同第3,658,520号明細書、同第4,23 2, 103号明細書、同第4, 175, 961号明細 書、同第4,012,376号明細書、特公昭49-3 5702号公報、同39-27577号公報、特開昭5 5-144250号公報、同56-119132号公 報、同56-22437号公報、西独特許第1,11 0.518号明細書等参照)、アミノ置換カルコン誘導 体(米国特許第3,526,501号明細書等参照)、 オキサゾール誘導体(米国特許第3、257、203号 明細書等に開示のもの)、スチリルアントラセン誘導体 (特開昭56-46234号公報等参照)、フルオレノ ン誘導体(特開昭54-110837号公報等参照)、 ヒドラゾン誘導体(米国特許第3.717.462号明 細書、特開昭54-59143号公報、同55-520 63号公報、同55-52064号公報、同55-46 760号公報、同55-85495号公報、同57-1 1350号公報、同57-148749号公報、特間平 2-311591号公報等参照)、スチルベン誘導体 (特開昭61-210363号公報、同61-2284 51号公報、同61-14642号公報、同61-72 255号公報、同62-47646号公報、同62-3 6674号公報、同62-10652号公報、同62-30255号公報、同60-93445号公報、同60 -94462号公報、同60-174749号公報、同 60-175052号公報等参照)、シラザン誘導体 (米国特許第4,950,950号明細書)、ポリシラ ン系 (特開平2-204996号公報)、アニリン系共 重合体(特開平2-282263号公報)、特開平1-211399号公報に開示されている準電性高分子オリ ゴマー (特にチオフェンオリゴマー) 等を挙げることが できる.

[0031] 正孔注入層の材料として比上記のものを使用することができるが、ポルフィリン化合物(特別配信3-2956965965時間、発音放射三級アミン化合物はびスチリルアミン化合物(米国時許第4,127,412号明報書、特開昭53-27033号公報、同54-58公報、同54-6429号公報、同55-

79450号公報、同55-144250号公報、同56-119132号公報、同61-295558号公報、同61-98353号公報、同63-295695 号公報等参照)、特に芳香放第三級アミン化合物を用いることが好ましい。

 $[0\ 0\ 3\ 2]$ 上記求ルフィリン化合物の代表例としては、ポルフィン、1, 10, 15, 20 ーテトラフェニルー21 H, 23 Hーボルフィン頓 (Π) 、1, 10, 15, 20 ーテトラフェニルー21 H, 23 Hーボルフィン範 (Π) 、5, 10, 15, 120 ーテトラキスイン亜鉛 (Π) 、5, 10, 15, 20 ーテトラキスイン亜鉛 (Π) 、5, 10, 15, 20 ーテトラキスイン亜鉛 (Π) 、5, 10, 15, 20 ーテトラキスクン・グリコンフタロシアニンオキシド、アルミニウムフタロンアニンのサンアニングのロンアニン、(無金剛)、 30 サラシカフロンアニン、のカフタロシアニン、銀フタロンアニン、カクロシアニン、亜鉛フタロンアニン、銀フタロンアニン、チクニウムフクロシアニンオンド、Mgフタロシアニン(別オクタメチルフタロシアニン学を挙げることができる。

【0033】また、前記芳香族第三級アミン化合物およ びスチリルアミン化合物の代表例としては、N、N、 N', N'ーテトラフェニルー4, 4'ージアミノフェ ニル、N, N' -ジフェニル-N, N' -ビス- (3-メチルフェニル) -[1, 1'-ビフェニル] - 4,4'ージアミン、2、2ーピス(4ージーpートリルア ミノフェニル) プロパン、1、1-ビス(4-ジーp-トリルアミノフェニル) シクロヘキサン、N. N. N', N'ーテトラーpートリルー4, 4'ージアミノ フェニル、1、1ービス (4-ジーp-トリルアミノフ ェニル) -4-フェニルシクロヘキサン、ビス(4-ジ メチルアミノー2-メチルフェニル)フェニルメタン、 ビス (4-ジーロートリルアミノフェニル) フェニルメ タン、N, N' ージフェニルーN, N' ージ (4ーメト キシフェニル) -4, 4'-ジアミノピフェニル、N, N, N', N'-テトラフェニル-4, 4'-ジアミノ フェニルエーテル、4,4'ービス(ジフェニルアミ クオードリフェニル、N、N、Nートリ(pートリ ル) アミン、4- (ジ-p-トリルアミノ) -4'-「4 (ジーpートリルアミノ) スチリル] スチルベン、 4-N, N-ジフェニルアミノー(2-ジフェニルビニ ル) ベンゼン、3-メトキシ-4'-N、N-ジフェニ ルアミノスチルベンゼン、N-フェニルカルバゾール等 を挙げることができる。また、発光層の材料として示し た前述の芳香族ジメチリディン系化合物も、正孔注入層 の材料として使用することができる。

【0034】正孔注入層としての厚さは特に制限されないが、通常は5nm~5μmである。この正孔注入層は、上述した材料の1種または2種以上からなる一層構造であってもよいし、同一組成または具種組成の複数層からなる復層構造であってもよい。

【0035】⑤電子注入層

必要に応じて設けられる電子往入層は、陰極より往入さ れた電子を発光層に伝達する機能を有していればよく、 その材料としては従来公知の化合物の中から任意のもの を選択して用いることができる。

【0036】具体例としては、ニトロ置換フルオレノン 誘導体、特開昭57-149259号公報、同58-5 5450号公報、同63-104061号公報等に開示 されているアントラキノジメタン誘導体、Polymer Prep rints, Japan Vol. 37, No. 3(1988) p. 681等に記載されてい るジフェニルキノン誘導体、チオピランジオキシド誘導 体、ナフタレンペリレン等の複素環テトラカルボン酸無 水物、カルボジイミド、Japanese Journal of Applied Physics, 27, L 269 (1988)、特開昭 6 0 - 6 9 6 5 7 号公 報、同61-143764号公報、同61-14815 9号公報等に開示されているフルオレニリデンメタン誘 導体、特開昭61-225151号公報、同61-23 3750号公報等に開示されているアントラキノジメタ ン誘導体およびアントロン誘導体、Appl. Phys. Lett., 55, 15, 1489や前述の第38回応用物理学関係連合講演会 で浜田らによって開示されたオキサジアゾール誘導体 特開昭59-194393号公報に開示されている一連 の電子伝達性化合物等が挙げられる。なお、特開昭59 194393号公報では前記電子伝達性化合物を発光 層の材料として開示しているが、本発明者の検討によれ ば、電子注入層の材料としても用いることができること が明らかとなった。

「0037」また、8-キノリノール情導体の金属館体、具体的にはトリス(8-キノリノール)アルミニウム、トリス(5, アージクロロー8-キノリノール)アルミニウム、トリス(5, アージブロモー8-キノリノール)アルミニウム、トリス(5, アージブロモー8-キノリノール)アルミニウム、トリス(2-メチルー8-キノリノール)アルミニウム等や、これらの金属館体の中心金属がIn、Mg、Cu、Ca、Sn、またはPbに置き代わった金属館体等も電子性入層の材料として用いることができる。その他に、メクルフリーあるいはメタルフクロジアニンまたはそれもの末端がアルキル底、スルホン基等で置換されているものも望ましい。また、発光層の材料として例示したジステリルビラジン誘導体も、電子社入園の材料として例ぶるとかできる。

【0038】電子往入層としての厚さは特に制限されないが、通常は5nm~5μmである。この電子往入層は、上述した材料の1種または2種以上からなる一層構造であってもよいし、同一組成または異種組成の複数層からなる物原構造であってもよい。

【0039】2. 封止層

前記構造体の外側に配設される封止層は、素子内部に酸 素や水分の侵入を防止するために設けられる。本発明に 用いられる封止層は、封止層形成モノマーを蒸着重合に よって前記構造体の外側に積層して形成する。 【0040】①蒸着電合 本発明に用いられる蒸着電金とは、真空蒸棄の原の加熱によりモノマーの重合が起こる現象のことをいい、例えば計止層形成材を、圧力が10°~10°P aの真空層中で、300°以下の温度で加熱し、対止層形成モノーを昇離させ、その昇雄の限に重合させて、前記精造体上に積層させることを挙げることができる。また、他の具体例としてはボートビシャッターを取り付けておき、ボートを加熱して対止層形成モノマーが重合を始めた時にシャッターを開け、それを前記構造体上に積層させることを挙げることができる。さらに他の具体例記しば、対止形形成モノマーがまたはオリゴーを入れませいでは、対止形形成モノマーがまたはオリゴーをは対しましては、対止形形成モノマー、またはオリゴーを大はオリゴーを立と、

【0041】②封止層形成モノマー

本発明に用いられる針止層形成をナマーとしては、上記 番着重合によって精造体上に預慮され、射止層を形成し うるものであれば特に制限はないが、たとえばエポキシ 系モノマー、光重合をするケイ皮酸エスアル領モノマ 、および発温をきするカルン領モノマーからなる群から選ばれる一以上のモノマーからなるを挙げることができる。たとえば、エポシキ系モノマーとしては、 エチレンオキンド、プロピレンオキシド、プチレンオキシ シド、ステレンオキシド、プロピレンオキシド、プチレンオキ シド、ステレンオキシド、プロピレンオキシド、グラレンオ シド、カケレンオキシド、クイ皮酸エステル領モノマー してはケイ皮酸エチル、ケイ皮酸インエイト等を挙 げることができ、カルベン領モノマーとしては、インシ アノ所能エチル、フェニルインシアナート、ジアソブタ シ等を挙げることができる。

【0042】③重合条件

蜜合条件については、特に制限はなく、封止層形成モノマーの種類に応じて適宜選択することができる。たとえば、封止層形成モノマーとして光重合するケイ度度エステルモノマーを用いる場合には紫外線を照射しながら積層、形成(落着)し、紫重合するカルペン類モノマーを用いる場合には蒸着時にボートを50~20℃で加熱しながら蒸着することを挙げることができる。

 明の方法を用いることにより、エポキシ樹脂を用いて封 止層を形成することが可能となった。

-【0044】蒸着される封止層の厚さについては、特に 制限はないが $1 \mu m \sim 1 mm$ が好ましい。

【0045】なお、この封止層と構造体との間に、また はこの封止層のさらに外側に、酸素や水分を遮断、吸 収、吸蔵もしくは消費する物質、またはその物質を含有 する材料からなる保護層、または封止層を形成してもよ い、

[0046]

【実施例】以下、本発明を実施例によってさらに具体的 に説明する。透明なガラス基板(HOYA社製、商品 名:NA-45)の表面を研摩し、微細な表面凹凸をな くした後、通常の有機洗浄処置を施し、さらにITOの 成膜の直前にUV/O。を用いた光洗浄処理を行った 後、真空蒸着にてシート抵抗が約10Q/□のITOを 成膜し、透明電極からなる陽極を形成した。この後、真 空槽内を5×10 Paまで減圧し、トリフェニルジア ミン (TPDA) の入ったボートを220℃まで加熱 し、真空蒸着により1000Å形成し、補助層とした。 引き続いてトリス (8-キノリノールアルミニウム (A 1 q,) を昇華精製したものを蒸着源とし、230℃ま で加熱し、真空蒸着により1000人の有機発光薄膜を 形成し、ついでMg-Inを蒸着源とし1500Å電子 ピーム蒸着により形成し、陰極とした。最後に、プテン オキシドをボート温度100℃に加熱すると、重合しな がら蒸着を開始した。これを5μm形成し封止層とし た。この素子を大気中25°Cで6V-3mA/cm²で 初期輝度100cd/m*で駆動したところ、半減時間 は2615時間であった。

【0047】比較例1

封止層としてボリパラキシリレンを用い、750℃に加 熱し、5 μ m形成したこと以外は実施例1と同様にして 素子を作製し、実施例1と同様にして半被寿命を測定し たところ、1295時間であった。

【0048】実施例2

封止層形成モノマーとしてスチレンオキシドを用い、1 20℃で蒸奪重合したこと以外は実施例1と同様に素子 を作製し、実施例1と同様にして半被寿命を測定したと ころ、2918時間であった。

【0049】実施例3

對止層形成モノマーとしてタイ皮酸エチルを用い、蒸着 槽内に取り付けていた紫外線照射装置で光重合を行いな がら150℃でポートを加熱したこと以外は実施例1と 同様にして素子を作製し、実施例1と同様にして半純寿 命を測定したところ、1812時間であった。

[0050]

【発明の効果】以上、説明したように本発明によって封 止層形成時の熱による劣化を防止し、長期に亘って安定 な発光特性が維持されるとともに長寿命の有機EL素子 を提供することができる。 【図面の簡単な説明】 【図1】本発明の有機EL素子の具体例を模式的に示す 断面図である。

【符号の説明】

1…基板

2…陽極

3…有機発光材料 4…陰極

5…封止層

10…構造体

2 0…有機E L素子

【図1】

20:有機EL等子

5:封止履

—3:有拱発光材料 10:構造体

_2:陽極

1.装板